### Лекция 20

# Реакционная способность твёрдых тел

НГУ, 2017

Реакционная способность — это способность вещества вступать в химическую реакцию. При твёрдофазных химических реакциях реакционная способность определяет скорость процесса, химический состав, кристаллическую структуру и морфологию (размер, форма) продукта реакции, а также пространственное протекание реакции (топологию реакции).

### Факторы, определяющие реакционную способность.



# Влияние кристаллической структуры

- Взаимное расположение атомов или молекул в кристалле
- Существование или отсутствие сходства между продуктом и исходным реагентом
- Энергетика образования и подвижность дефектов в продукте и исходном реагенте

# Ограниченная подвижность частиц, предопределенное положение частиц

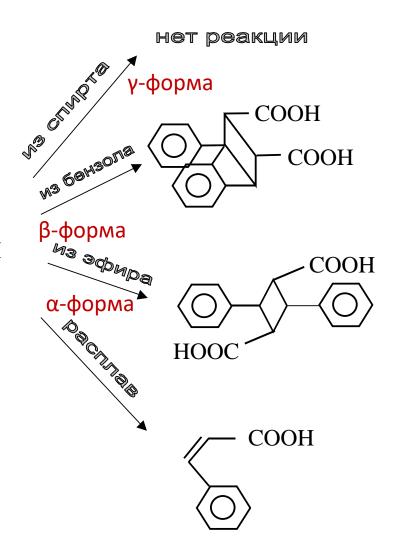
• Реакции внутри одного кристаллика

Расположение частиц в структуре ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО, и, в силу их низкой подвижности, задает возможность или невозможность вступления в реакцию, а также состав и структуру продуктов

«Топохимический принцип», «метод предшественника», «топотаксиальные реакции», «понятие реакционной полости», «реакции в микрореакторах», возможность управлять химическими и физическими свойствами через структуру

# Влияние взаимного расположения молекул в кристалле

Действие света на коричную кислоту



## Влияние взаимного расположения молекул в кристалле

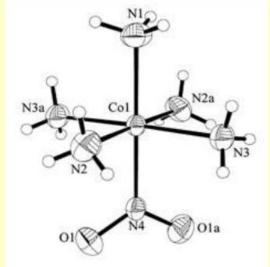
Топохимический принцип Шмидта – Коэна – реакция димеризация происходит только в случае, если в соседних молекулах двойные связи расположены параллельно на расстоянии менее 4 А.

# Влияние взаимного расположения молекул в

кристалле

Внутрисферная связевая изомеризация в комплексах Co(III)

$$[\text{Co(NH}_3)_5\text{ONO}]\text{An}$$
  $\xrightarrow[h\nu]{\text{T}}$   $[\text{Co(NH}_3)_5\text{NO}_2]\text{An}$ 

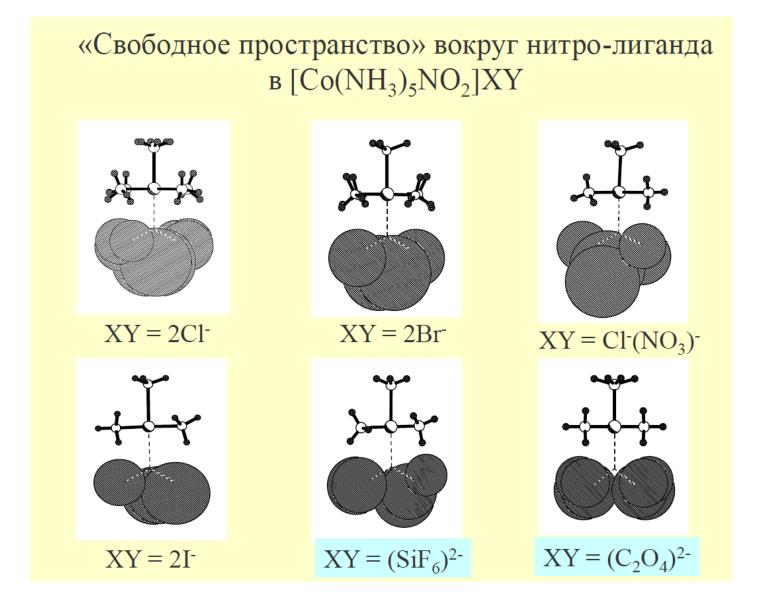


**Раствор**: 75% red-ох разложение + 25% связевая изомеризация

**Кристаллы:** An = 2Cl<sup>-</sup>, 2Br<sup>-</sup>, 2I<sup>-</sup>, 2F<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>(NO<sub>3</sub>)<sup>-</sup>, 2(NO<sub>3</sub>)<sup>-</sup>, (SO<sub>4</sub>)<sup>2-</sup>, etc.  $\Rightarrow$  100% связевая изомеризация

 $An = (C_2O_4)^{2-} \Rightarrow$  нет фотоизомеризации, 100% red-ох разложение

An =  $(SiF_6)^{2-} \Rightarrow$  неполная фотоизомеризация (40%), нет red-ох разложения



Уменьшение «реакционной полости» вблизи нитро группы в случае «больших» анионов  $\mathrm{SiF}_6^{2-}$ ,  $\mathrm{C_2O_4^{2-}}$  затрудняет реакцию.

Топотаксия - это наследование продуктом структурных элементов исходного реагента. Если наследуется трёхмерный каркас, то топотаксия называется трёхмерной, если плоскости - двумерной, а если цепочки - одномерной.

## Примеры топотаксиальных реакций.

#### Трёхмерная топотаксия

#### Двумерная топотаксия

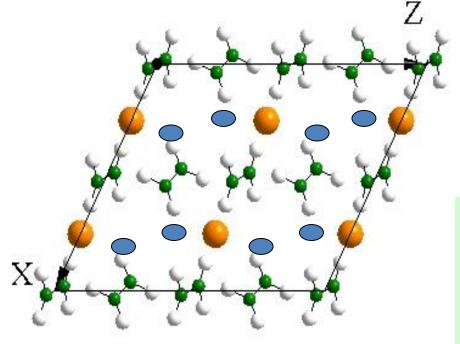
$$\begin{array}{cccc} a\text{-Fe}_2\mathrm{O}_3 & \longrightarrow & \mathrm{Fe}_3\mathrm{O}_4 \\ & \mathrm{CoOOH} & \longrightarrow & \mathrm{Co}_3\mathrm{O}_4 \\ \delta\text{-MnOOH} & \longrightarrow & \mathrm{Mn}_3\mathrm{O}_4 \\ \gamma\text{-NiOOH} & \longrightarrow & \mathrm{Ni(OH)}_2 \\ & \mathrm{Ni(OH)}_2 & \longrightarrow & \mathrm{NiO} \\ & \mathrm{Co(OH)}_2 & \longrightarrow & \mathrm{CoO} \\ & \mathrm{Mg(OH)}_2 & \longrightarrow & \mathrm{MgO} \end{array}$$

интеркаляция различных веществ в графит и глинистые минералы, дегидратация и реакции ионого обмена в слоистых силикатах и каолините.

Трёхмерная

 $BaC_2O_4 \cdot H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O \leftrightarrows \alpha - BaC_2O_4 \cdot H_2C_2O_4 + 2H_2O(\Gamma)$ 

вакуум ( $P \sim 10^{-2} \Pi a$ ), T < 323 K

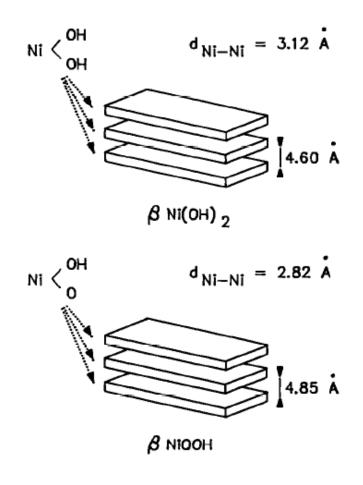


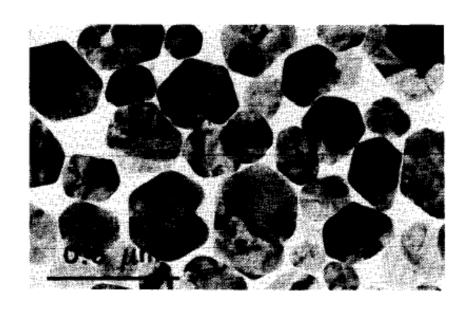
Кислый оксалат бария дигидрат C2/c, a=14.45 A, b=5.4 A, c=12.45 A, β=116°

Безводная вакансионная структура C2/c, a=15.39 A, b=4.88 A, c=12.36 A, β=118.8°

двумерная

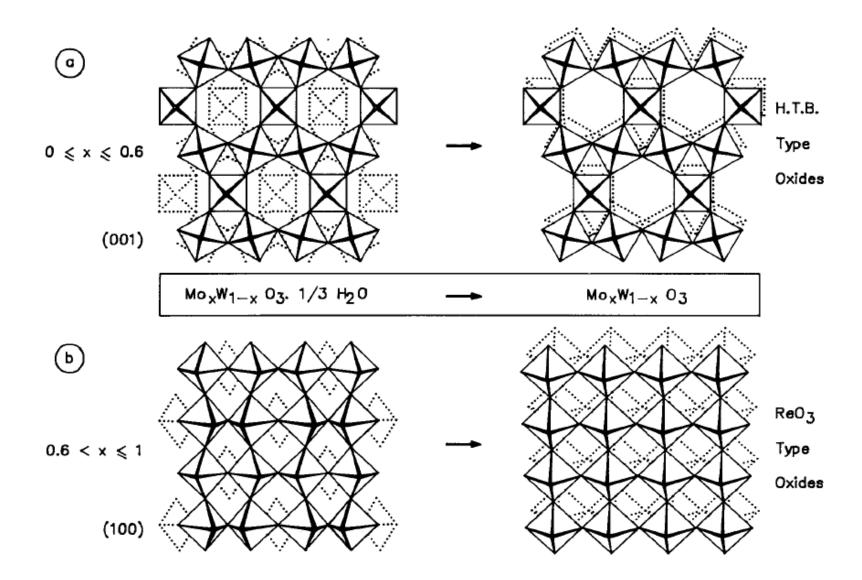
$$Ni(OH)_2 = NiOOH + H^+ + e'$$



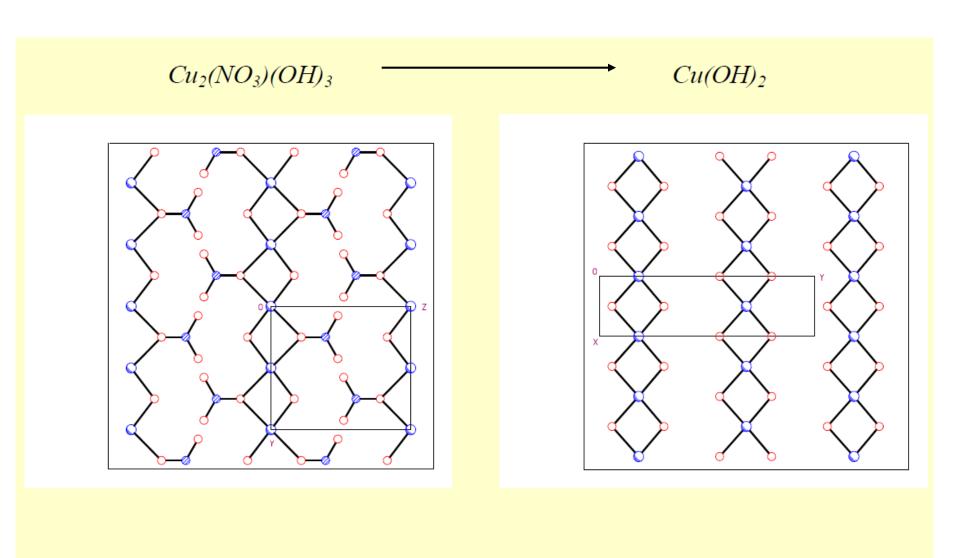


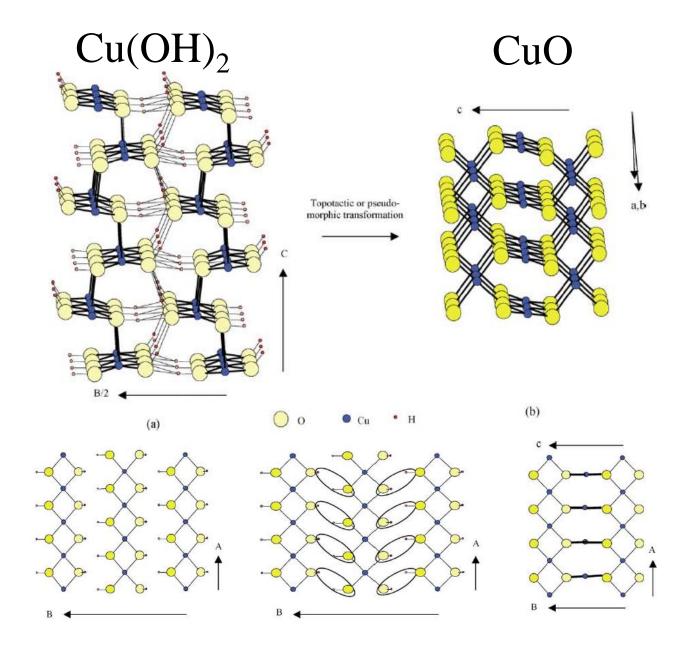
(001) β(III) // (001) β(II) (110) β(III) // (110) β(II)

двумерная



одномерная





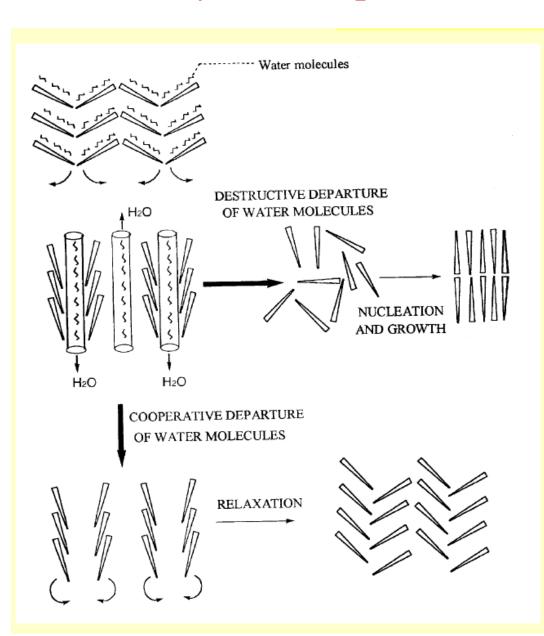
# Кристаллические структуры продуктов твердофазных реакций

• Из разных <u>предшественников</u> могут быть получены разные кристаллические структуры

• В различных условиях могут быть получены разные кристаллические структуры

• Часто образуются **метастабильные**, неравновесные кристаллические структуры

# Влияние условий реакции на структуру продукта



Дегидратация в вакууме часто дает аморфные продукты, Дегидратация в парах воды – кристаллические.

Изменение условий дегидратации может давать новые полиморфы – продукты дегидратации

# Применение к α-лактозе

Эксипиент для са. 2000 фармацевтических продуктов

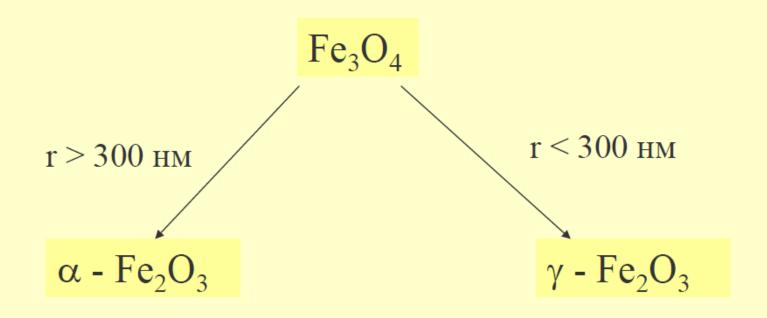
Три кристаллические формы: моногидрат и две безводные формы ( $\alpha_{\rm S}$  и  $\alpha_{\rm H}$ )

 $\alpha_{\rm H}$ : получают нагреванием моногидрата при 120°C в течение 2-3 часов; гигроскопична (обратимая дегидратация) Дегидратация, дающая  $\alpha_{\rm H}$  – топотаксиальная реакция

 $\alpha_{\rm S}$ : получают из суспензии моногидрата в EtOH в течении 24 часов при 25°C, или при нагревании при са. 170°C;

Устойчивая форма (необратимая дегидратация) Дегидратация, дающая  $\alpha_{\rm S}\,$  - реорганизация структуры, образование и рост зародышей

# Размерные эффекты:



Устойчивая, неактивная

Метастабильная, активная

# Разные структуры – разные свойства

	γ-Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	α-Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
цвет	коричневый	кирпичный
магнитные	Ферро-	Пара-
свойства	магнетик	магнетик
Катализ	Очень	Очень
разложения H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	сильный	слабый
Влияние на pocт Lepisepticum	Очень сильное	отсутствует
bacteria		
Влияние на	Сильно	отсутствует
продолжи-	возрастает	
тельность		
жизни		
pneumococcs		
(Dubos-		
Baudisch test)		

# Некоторые физические и химические свойства, которыми могут различаться полиморфы

- температура плавления
- давление паров
- твердость, спайность
- оптические, электрические, магнитные свойства, окраска
- колебательные спектры
- ЯМР спектры

- молекулярные конформации
- фотохимическая реакционная способность
- термическая устойчивость
- фильтруемость, способность к сушке
- таблетируемость
- скорость растворения
- биодоступность

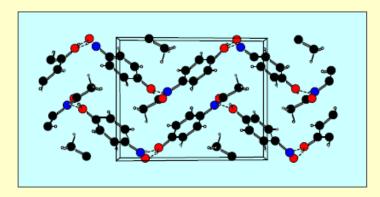
## Разные структуры – разные свойства

Особое значение – для фармации

Примеры (продолжение):

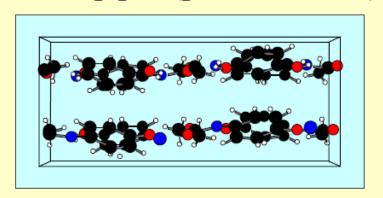
#### Парацетамол

Полиморф I (моноклинный)



менее активный устойчивый плохо таблетируется

Полиморф II (ромбический)



более активный нестабильный хорошо таблетируется

Дефекты в кристаллах Микротрещины и фигуры роста Габитус Дислокации Гетерогенные примеси Точечные дефекты Schottky Frenkel **4** b Гомогенные примеси

#### Декорирование.

Дислокации являются местами ускоренной диффузии и облегченного зарождения при химических реакциях. Химические реакции позволяют визуализировать дислокационную структуру.

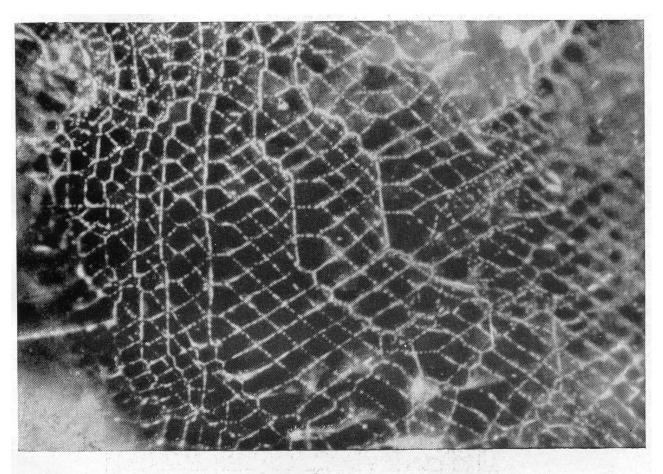
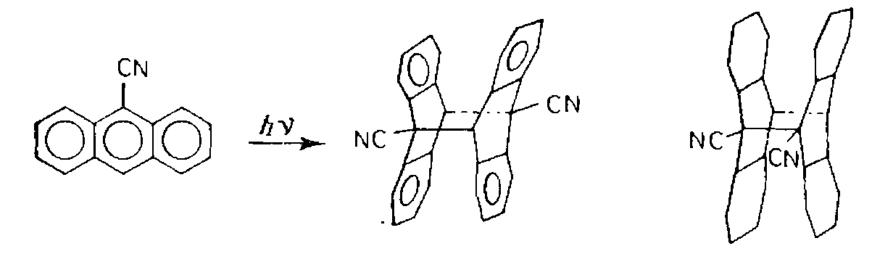


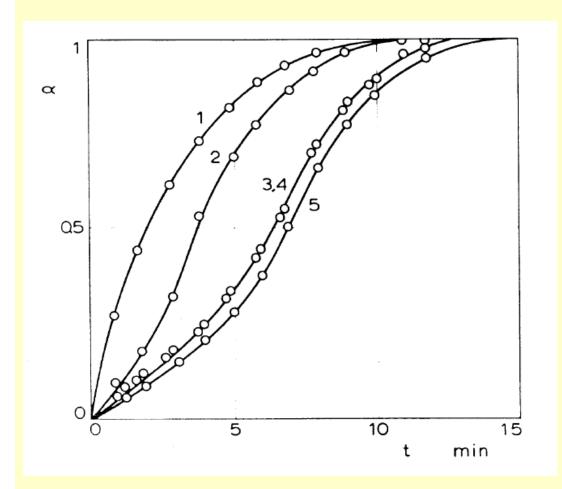
Фото 12. Пример декорированной малоугловой границы в КС1 [23], × 420.

### Фотодимеризация 9-цианоантрацена



В исходном кристалле молекулы расположены «голова» к «голове» и следовало бы ожидать образование цис-димера. Но в результате реакции образуется транс-изомер. Это связано с тем, что фотодимеризация происходит на дефектах упаковки. В ходе реакции происходит образование новых дефектов упаковки и дальнейшее протекание реакции.

# Влияние старения



Термическое разложение PbC<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

- 1 свежеприготовленный
- 2 хранился 1 день
- 3 хранился 4 дня
- 4 хранился 10 дней
- 5 хранился 30 дней

Химический состав и структура не изменяются. Изменяется концентрация дислокаций.

### Пример: термическое разложение NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>

Перхлорат аммония (ПА) разлагается с заметной скоростью В широком интервале температур 200 - 500°C.

Термостабильность ПА намного ниже, чем перхлоратов щелочных металлов (e.g. RbClO<sub>4</sub> разлагается при 400°С). В отличие от перхлоратов щелочных металлов, термическое разложение перхлората аммония очень чувствительно к предварительному облучению, чистоте образца, механическому воздействию.

Маленькие кристаллы ПА устойчивее крупных.

Несмотря на то, что в ходе термического разложения ПА образуются только газообразные продукты, так что поверхность не блокируется твердым продуктом, при температурах ниже 300°C реакция останавливается при степени превращения около 30%.

#### Проблема:

Важно для практических приложений

- как увеличить срок хранения?

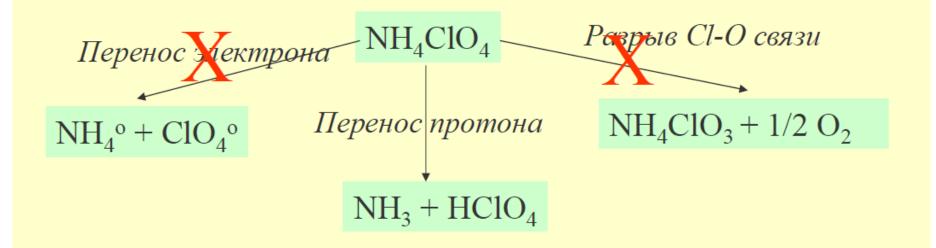
стабилизация

- как добиться полного протекания реакции?

повышение реакционной способности

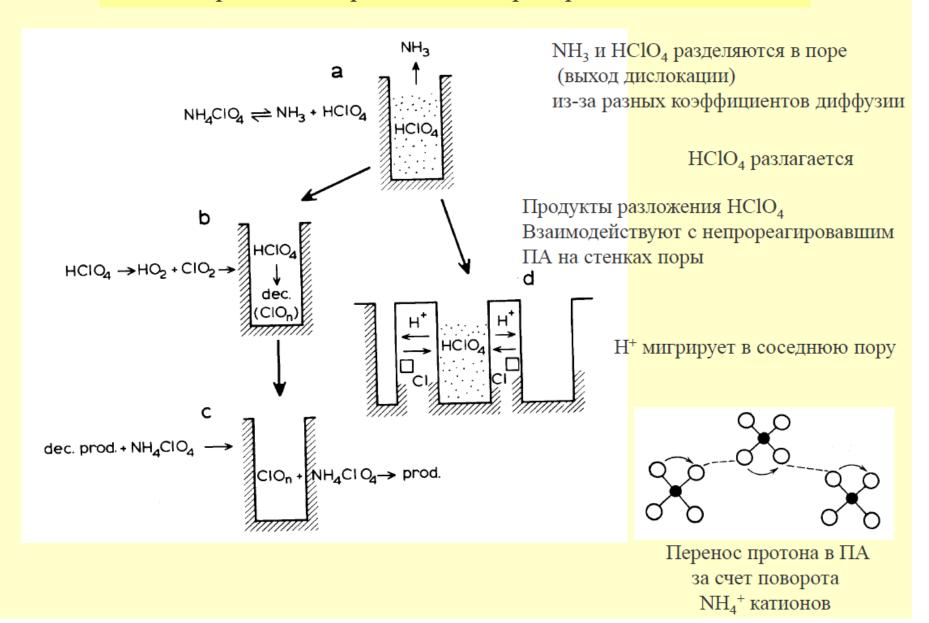
Для решения проблемы нужно знать механизм реакции

#### Химия разложения



- Какой из вариантов верен?
- Где локализованы данные стадии?
- Как можно влиять на реакцию?

# Схематичное представление локализации и автолокализации термического разложения перхлората аммония



#### Локализация и автолокализация термического разложения перхлората аммония

- Термическое разложение начинается на дислокациях.

ядра

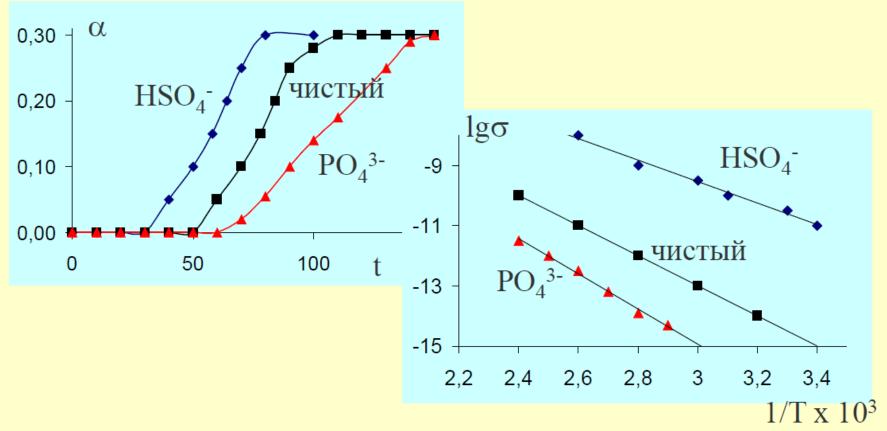
- Во время разложения наблюдаются сигарообразные "зародыши", вытянутые вдоль одного кристаллографического направления. Эти "зародыши" состоят из многих пузырьков и прекращают расти, достигнув определенного размера.
- Вблизи растущих "зародышей" образуются новые дислокации.

- Направления, в которых вытянуты "зародыши" совпадают с направлением скольжения дислокаций.



Поверхность разложенного кристалла

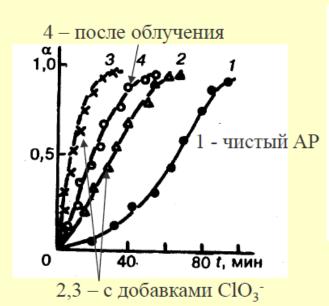
# Допирование NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> как метод управления термической устойчивостью

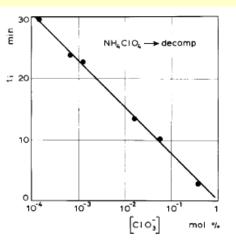


Акцепторы протонов: уменьшают протонную проводимость, ингибируют термическое разложение

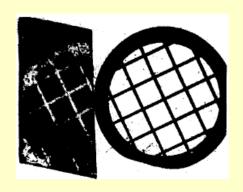
Доноры протонов: повышают протонную проводимость, ускоряют термическое разложение

#### Влияние предварительного облучения NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>





Влияние концентрации ClO<sub>3</sub>на индукционный период



фотографическое изображение на кристалле ПА (облучение + разложение)

Облучение ПА генерирует ионы ClO<sub>3</sub>-

Термическое разложение начинается в облученных областях

Ионы ClO<sub>3</sub>- могут быть введены в кристалл при кристаллизации.

#### Рекомендации по увеличению срока хранения ПА

1. Максимально очищать от примесей  $ClO_3^-$ . Вводить в качестве примесей  $SO_4^{2-}$  or  $PO_4^{3-}$ .

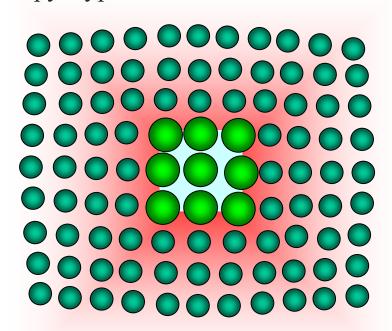
2. Избегать предварительного облучения.

3. Избегать условий, в которых образуются дислокации. (Избегать пластической деформации, брать мелкие частицы)

# Причины возникновения механических напряжений в результате твердофазных реакций

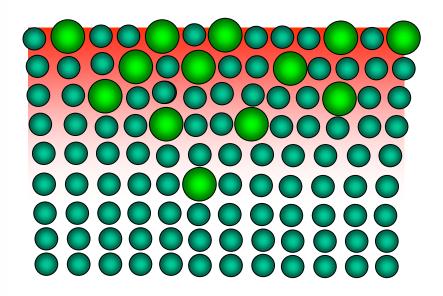
#### Структурные напряжения -

несоответствие параметров структуры.

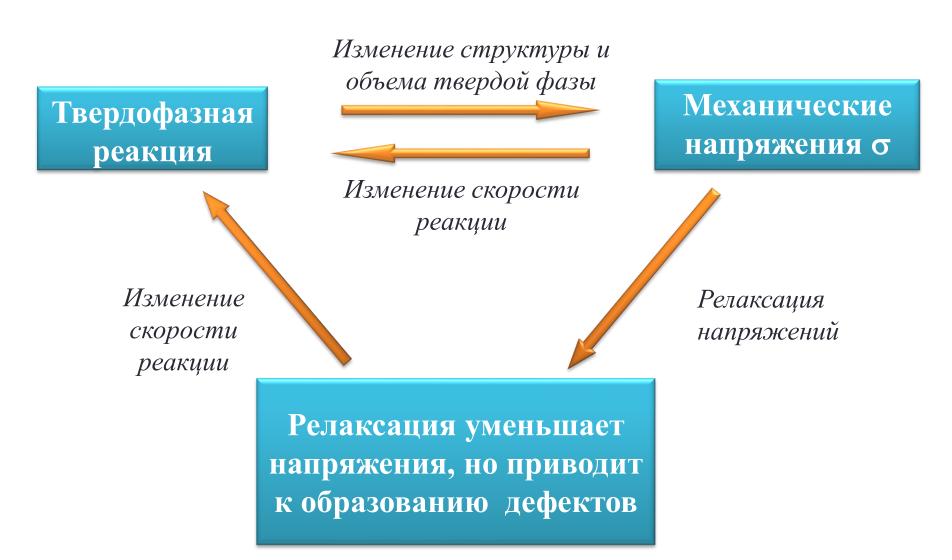


#### Дилатационные напряжения -

несоответствие объема, приходящегося на один узел решетки.



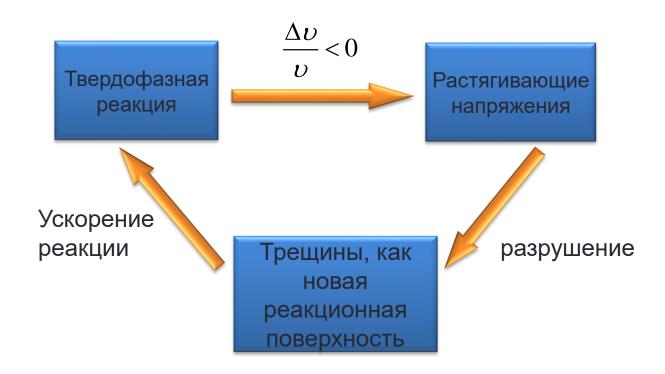
# Роль механических явлений в твердофазных реакциях



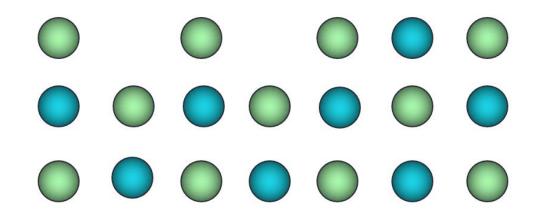
#### Механизмы релаксации механических напряжений



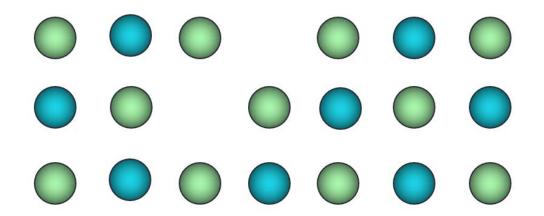
# Обратная связь между реакцией и разрушением



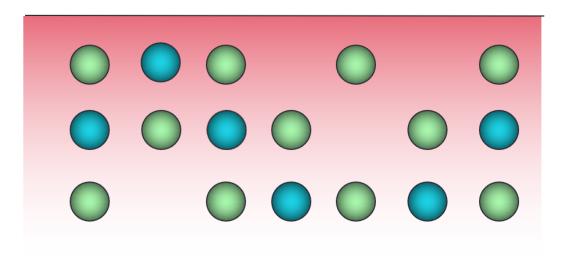
Механические явления наиболее ярко проявляются при реакциях термического разложения. При этих реакциях происходит значительное уменьшение объёма и разрушение в реакционной зоне.



Реакция на поверхности

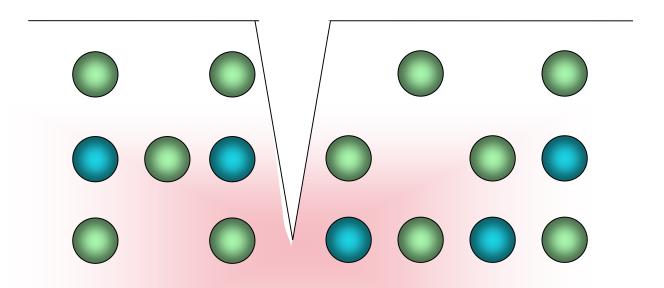


Реакция на поверхности Образование вакансионной структуры

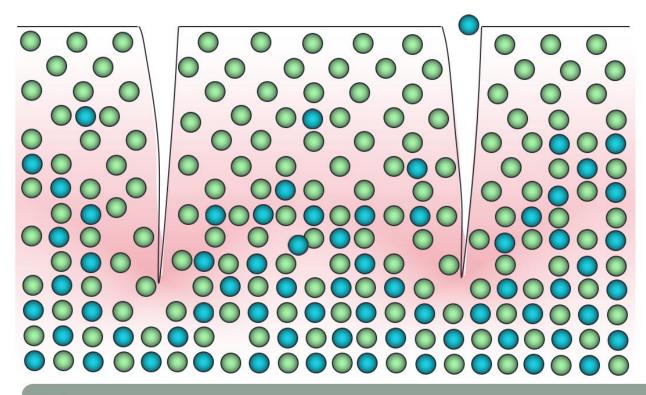


Реакция на поверхности
Образование вакансионной структуры
Рост напряжений в поверхностном слое

Критерий для образования трещины: величина упругой энергии, которая релаксирует при разрушении, должна быть больше или равна энергии поверхностей образовавшихся при росте трещины.



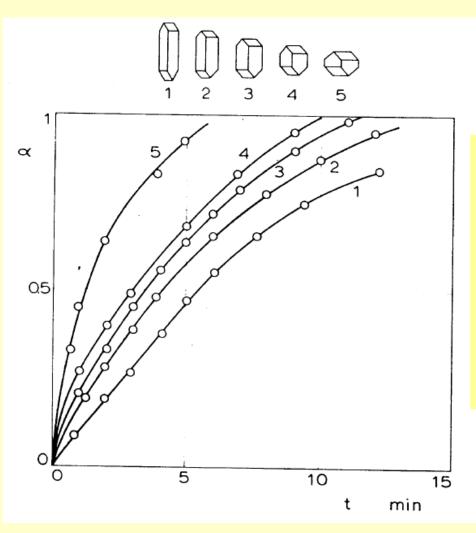
Образование трещины Релаксация напряжений Ускорение реакции



Образование совместного фронта реакции и разрушения – механо-реакционного фронта.

Механические явления определяют морфологию и кинетику реакций термического разложения.

### Влияние формы частиц



Скорость реакции может различаться для разных граней.

В этом случае изменения формы кристалла заметно скажется на скорости процесса.

Дегидратация  $MgSO_4$  х 7  $H_2$ О при 50°С

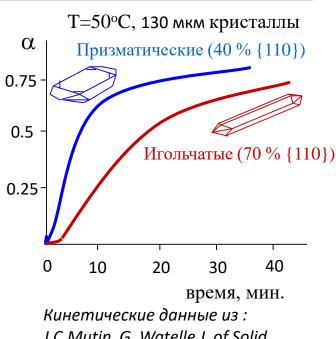
#### Зависимость скорости реакции от габитуса кристалла

Скорость фронта реакции:

$$V \sim D/h$$
 ,

где D – коэффициент диффузии молекул воды в вакансионной структуре ; h – масштаб разрушения.

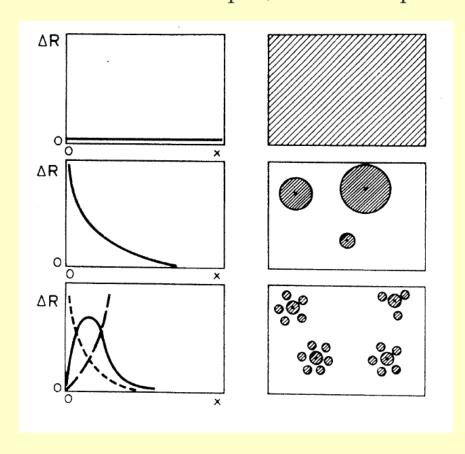
$$h_{(100)} < h_{(110)}$$
  
 $V_{(100)} > V_{(110)}$ 



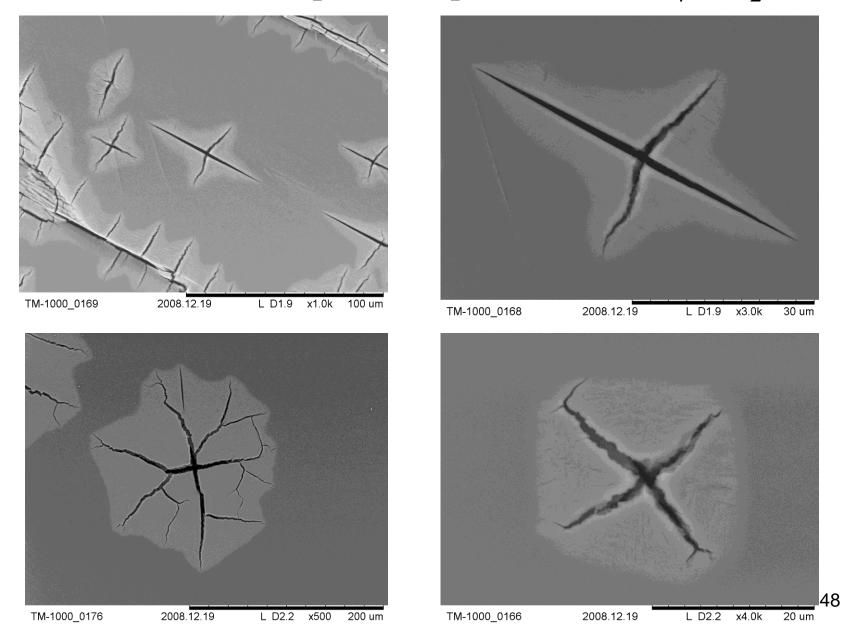
J.C.Mutin, G. Watelle J. of Solid State Chem. 28 (1979), 1-12.

 $D \sim 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{c}$  — коэффициент диффузии молекул воды в вакансионной структуре, полученный из экспериментальных данных.

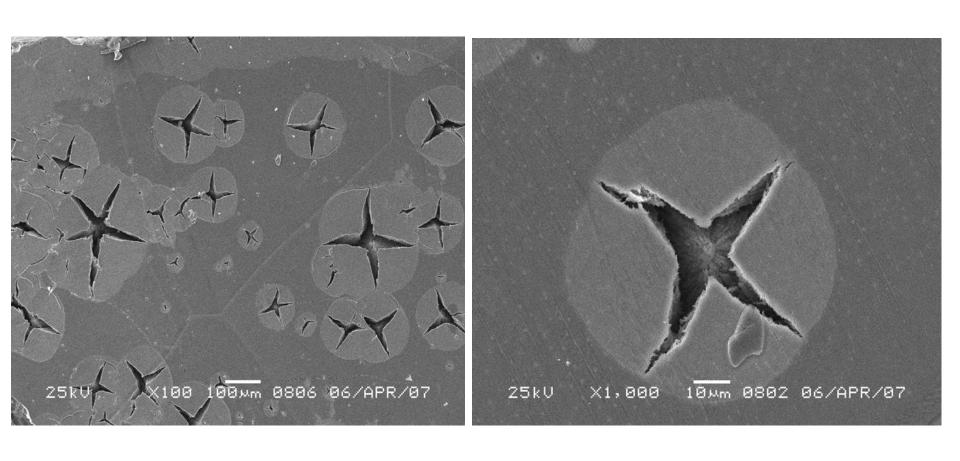
## **Локализация** и **автолокализация** твердофазных реакций Положительная / отрицательная обратная связь

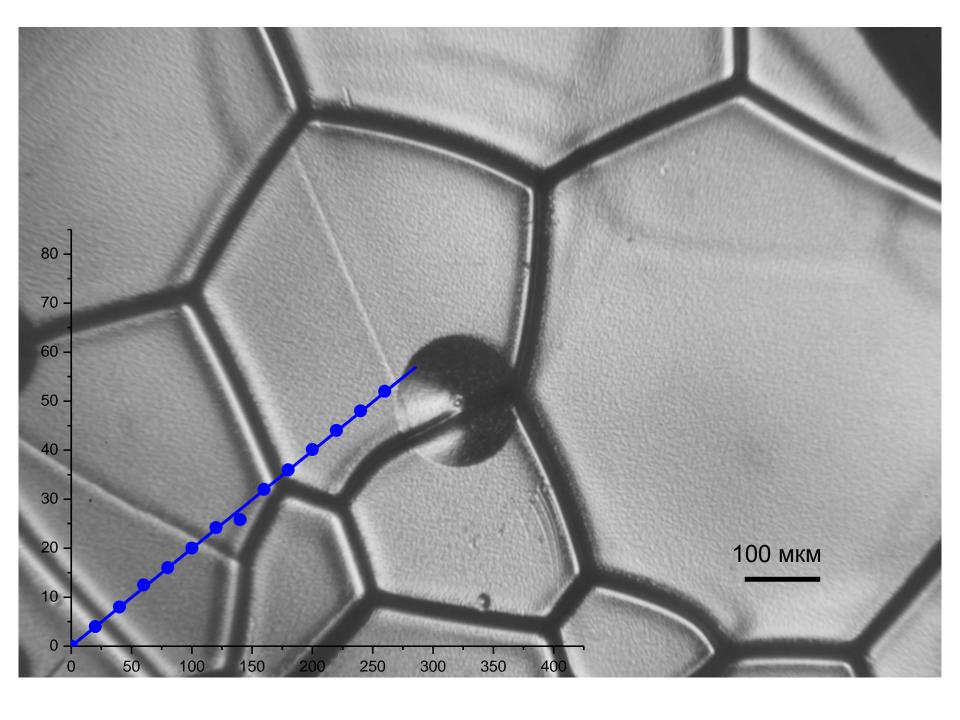


### Автолокализация при дегидратации NiSO<sub>4</sub>\*6H<sub>2</sub>O.



# Автолокализация при восстановлении Cu<sub>2</sub>O водородом или CO.





### Причины автолокализации процесса.

- 1. Различие реакционной способности поверхности и объёма или различных мест на поверхности.
- 2. Зарождение на дефектах кристалла.
- 3. Возникновение механических напряжений на границе раздела фаз и их релаксация через образование дефектов.
- 4. Изменение условий протекания электронных и ионных процессов при появлении продукта реакции.
- 5. Влияние газообразных или жидких продуктов реакции на реакционную способность исходного реагента.

